

ナノテクノロジープラットフォーム事業に
新しい装置を導入しました。

微量ガス分析装置 (GC/MS) を用いて、各種材料や稼動状態
の電子部品から発生する極微量のガス分析が可能

学内外を問わず広くご利用いただけます。

講演会

ダイナミック昇温脱離ガス分析装置の 基礎と応用

参加費無料

13:30～15:00

■ 前処理装置とGC/MSによる測定原理

ガスクロマトグラフィー／マススペクトルの役割と測定原理を解説し、一般的な応用例を紹介する

15:10～16:40

■ ダイナミック昇温脱離ガス分析装置の応用

ダイナミック昇温脱離ガス分析装置を幅広く利用いただけるように、特徴であるデバイスや部品に電力を供給し、稼動状態で脱離ガスの分析を含め、測定レシピを紹介する

講 師

日本電子株式会社 分析機器ソリューション営業本部
工学博士 樋口 哲夫

■ 講演後に昇温脱離ガス分析装置の見学を行います。

日時: 2014年4月24日(木) 13:30～16:40

会場: 山口大学常盤キャンパス 先端研究棟3F セミナー室

参加料: 無料

申込み方法: 2014年4月22日(火)までにお申し込みください。

(当日参加も歓迎しますが、準備の都合上なるべく事前にご連絡ください。)

お申込み・お問い合わせ先: 山口大学 大学研究推進機構 微細加工支援室

TEL: 0836-85-9976(立花) E-mail: nanotech@yamaguchi-u.ac.jp

FAX: 0836-85-9993